

1. 支援利用負担金

機器利用料（消費税込み、ARIM 微細加工プラットフォーム、ARIM 物質合成プラットフォーム）

※1 () 括弧内料金はデータ提供する場合の料金

※2 N71~N75 は付帯装置の為、データ提供する場合の料金はございません。			成果非公開		成果公開		備考
			大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等	
装置番号	ARIM 装置番号	装置名	円/15分 ※1	円/15分 ※1	円/15分 ※1	円/15分 ※1	
F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置 (NanoFab)	18,000 (15,000)	27,000 (22,500)	6,000 (5,000)	9,000 (7,500)	
I21	OS-114	RF スパッタ成膜装置 (金属成膜用)	7,500 (6,225)	11,250 (9,340)	2,500 (2,075)	3,750 (3,115)	Au, Pt は別途請求
I22	OS-115	RF スパッタ成膜装置 (絶縁体成膜用)	6,900 (5,775)	10,350 (8,665)	2,300 (1,925)	3,450 (2,890)	Au, Pt は別途請求
I23	OS-110	リアクティブイオンエッチング装置 (10NR)	7,500 (6,225)	11,250 (9,340)	2,500 (2,075)	3,750 (3,115)	
I24	OS-109	深掘りエッチング装置 (400iPB)	11,250 (9,375)	16,875 (14,065)	3,750 (3,125)	5,625 (4,690)	
I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィ装置 (125keV EBL)	13,500 (11,250)	20,250 (16,875)	4,500 (3,750)	6,750 (5,625)	
N01	OS-102	SEM 付集束イオンビーム装置 (Nvision)	90,000 (7,500)	13,500 (11,250)	3,000 (2,500)	4,500 (3,750)	
N02	OS-111	リアクティブイオンエッチング装置 (10NOU)	4,500 (3,750)	6,750 (5,625)	1,500 (1,250)	2,250 (1,875)	
N03	OS-113	多元 DC/RF スパッタ装置	9,000 (7,500)	13,500 (11,250)	3,000 (2,500)	4,500 (3,750)	Au, Pt は別途請求
N04	OS-116	誘導結合型 RF プラズマ支援スパッタ装置 (ICP-RF スパッタ装置)	4,200 (3,525)	6,300 (5,290)	1,400 (1,175)	2,100 (1,765)	Au, Pt は別途請求
N05	OS-117	EB 蒸着装置	4,500 (3,750)	6,750 (5,625)	1,500 (1,250)	2,250 (1,875)	Au, Pt は別途請求
N07	OS-126	接触式膜厚測定器	4,350 (3,600)	6,525 (5,400)	1,450 (1,200)	2,175 (1,800)	
N08	OS-107	マスクアライナー	4,200 (3,525)	6,300 (5,290)	1,400 (1,175)	2,100 (1,765)	
N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィ装置 (50keV EBL)	13,500 (11,250)	20,250 (16,875)	4,500 (3,750)	6,750 (5,625)	
N10	OS-104	自動搬送電子ビーム描画装置 (150kV BODEN)	15,000 (12,525)	22,500 (18,790)	5,000 (4,175)	7,500 (6,265)	

※2 N71～N75は付帯装置の為、データ提供する場合の料金はございません。			成果非公開		成果公開		備考
			大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等	
装置番号	ARIM装置番号	装置名	円/15分 ※1	円/15分 ※1	円/15分 ※1	円/15分 ※1	
N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	2,100 (1,725)	3,150 (2,590)	700 (575)	1,050 (865)	
N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡	2,175 (1,800)	3,265 (2,700)	725 (600)	1,090 (900)	
N33	OS-128	物理特性測定装置 (PPMS)	6,150 (5,100)	9,225 (7,650)	2,050 (1,700)	3,075 (2,550)	
N62	OS-119	自動制御型パルスレーザー蒸着ナノマテリアル合成装置	9,000 (7,500)	13,500 (11,250)	3,000 (2,500)	4,500 (3,750)	
S01	OS-108	ナノインプリント装置	5,850 (4,875)	8,775 (7,315)	1,950 (1,625)	2,925 (2,440)	
S32	OS-120	薄膜X線回折装置	3,750 (3,150)	5,625 (4,725)	1,250 (1,050)	1,875 (1,575)	
S35	OS-123	ナノ粒子解析装置（ゼータサイザー）	3,000 (2,475)	4,500 (3,715)	1,000 (825)	1,500 (1,240)	
N71		タングステンコーター	415	620	140	210	※2
N72		プラズマクリーナー	415	620	140	210	※2
N73		スピコーター	415	620	140	210	※2
N74		UV オゾンクリーナー	415	620	140	210	※2
N75		ワイヤーボンダー	415	620	140	210	※2

- ・利用時間とは装置予約時間（使用の有無は問わない）を指し、予約時間前後に延長利用した場合はその時間も含む（ただし予約無しで利用できる装置(N07、N71～N75)は、実使用時間を利用時間とする）
- ・上記は15分あたりの単価であり、これに利用時間を乗じた額を機器利用料とする。
- ・装置予約の取り消しは予約日開始時間の24時間前に締め切り、それ以降の取り消しについては当該予約の100%に相当する額を徴収する。
- ・一予約当たりで15分未満の端数は切り上げ、15分として算出する。

但し、1 課題毎の装置利用料の上限額（消費税込み）は次項の通りとする。

※1 ( ) 括弧内料金はデータ提供する場合の料金

	成果非公開		成果公開	
	大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等
装置利用料・月極金額 (円/月)	1,800,000	2,700,000	600,000	900,000
※1	(1,350,000)	(2,025,000)	(450,000)	(675,000)
装置利用料・年極金額 (円/年)	21,600,000	32,400,000	7,200,000	10,800,000
※1	(16,200,000)	(24,300,000)	(5,400,000)	(8,100,000)

技術支援料（消費税込み、ARIM 微細加工プラットフォーム、ARIM 物質合成プラットフォーム）

支援内容	成果非公開		成果公開	
	大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等
	円/15分	円/15分	円/15分	円/15分
技術代行			1,000	1,500
技術補助、オペレーショントレーニング	750	1,125	250	375

- ・上記は 15分あたりの単価であり、これに利用時間を乗じた額を技術支援料とする。
- ・一予約当たりで15分未満の端数は切り上げ、15分として算出する。

クリーンルーム入室料（消費税込み、所属区分や成果公開区分によらず同額）

課金対象となる部屋	円/日・人	備考
I215 室	500	上限 5,000 円/月
N415 室	500	上限 5,000 円/月

成膜用材料、レジスト等一部の消耗品は実費負担とする

消耗品費の額については、拠点長が別途告示する

消耗品の取り扱いに関して

- ・レジスト（ZEP520A）は性能の保証をしかねる為、4月より提供中止にさせていただきます。ご自身でのご購入をお願い致します。  
なお、クリーンルーム内での管理は可能ですが、盗難・紛失等のご対応はできかねます。  
（参考代理店）ファインマテリアルシステム有限会社 03-3811-7588
- ・シリコンウエハの種類が多岐にわたり保有・管理が困難なため、4月より提供中止にさせていただきます。ご自身でのご購入をお願い致します。  
（参考代理店）株式会社エレクトロニクスエンドマテリアルズコーポレーション 0797-34-7007